

最大加速電圧200 kV:電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]

装置分類: 電子ビーム描画装置

メーカー: 日本電子株式会社

装置型番: JBX-8100/G3

主な仕様: 最大加速電圧200 kVのポイントビーム

対応試料: シリコン、化合物半導体、石英、サファイヤ、等の電子材料基板

利用目的: 先端半導体、量子デバイス、フォトニクス、スピントロニクス、等

キーワード: リソグラフィ、EB描画、ナノパターニング、レジスト、次世代半導体

担当部署: 微細加工ユニット



装置HP



図1: 装置実機外観写真

装置概要・アピールポイント

- 国内の共用設備としてオンリーワンの最大加速電圧200 kVのフラッグシップモデル
- 数mm角の小片チップから最大8インチウェハまで対応した12段カセットローダー搭載
- シングルナノの極微細パターンからマイクロパターンまで幅広い用途で利用可能
- 高精度なフィールド繋ぎ合わせ、パターン重ね合わせ描画が可能
- 高速描画を実現するスキャンアルゴリズムにより、アレイパターン等の高速描画が可能

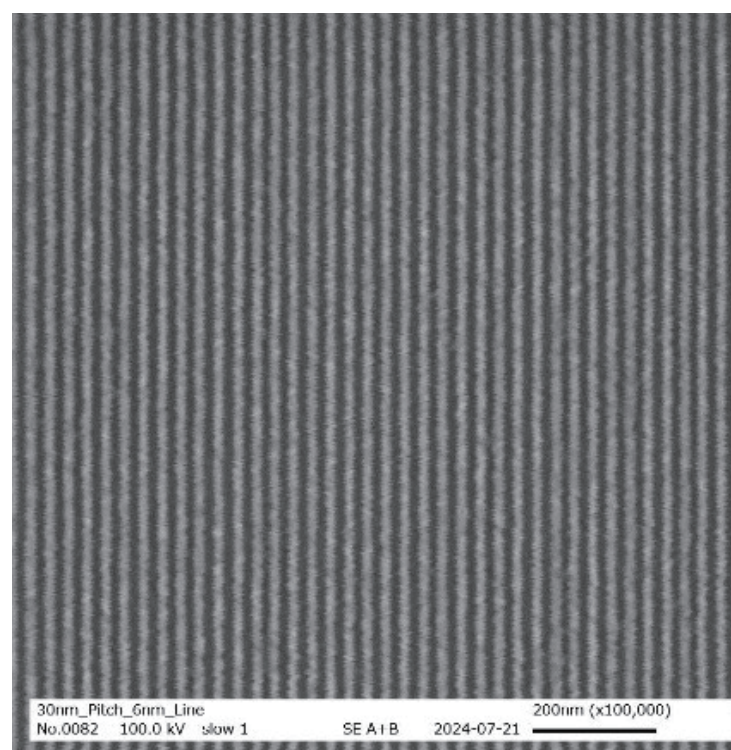


図2: 15 nmL/Sの極細線パターン

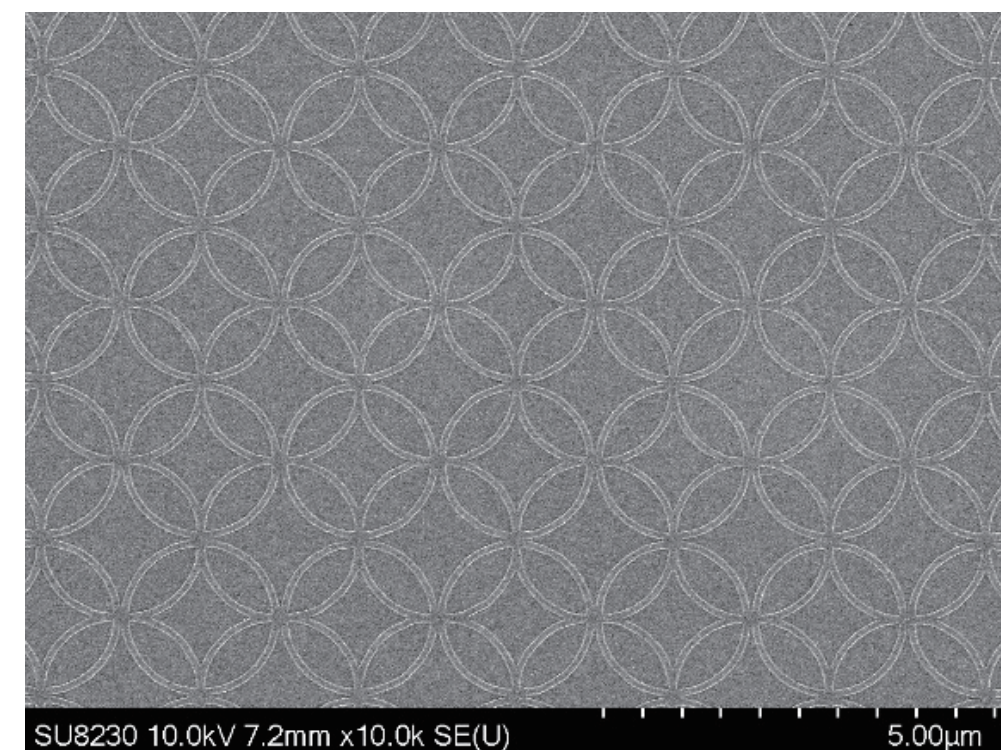


図3: 高精度な繋ぎ合わせ描画